

CONFERENCE REPORTS (3)

第4回表面科学討論会

吉原 一 紘

金属材料技術研究所

〒153 東京都目黒区中目黒 2-3-12

(1985年1月30日 受理)

The 4th Conference on Surface Science

Kazuhiro YOSHIHARA

National Research Institute for Metals

2-3-12, Nakameguro, Meguro,ku, Tokyo, 153

(Received January 30, 1985)

The 4th Japanese conference on surface science was held at Waseda University on December the 6th through December 7th, 1984.

Thirty papers including 3 invited lectures were presented and about 110 scientists and engineers attended the conference.

1. 経 過

日本表面科学会主催の第4回表面科学討論会が19学協会の協賛を得て、昭和59年12月6日、7日の2日間、早稲田大学小野記念講堂（東京都新宿区西早稲 1-6-1）で行われ、116人の研究者が参加し、最後まで熱心な討論が続けられ、非常に盛会のうちに会を終了した。

この討論会は、日本表面科学会の会員同志の情報交換の重要な場であるとして、年1回定期的に開催している。討論会の内容、規模、討論時間等は前3回に準じて行われたが、会場は今回は早稲田大学の御厚意により小野記念講堂を使わせていただいた。なお、今回も前回と同様に、12月6日夕刻より大隈会館において懇親会が開かれ、清山哲郎会長以下約20名の参加を得て、和気あいあいのなかで話はずみ、時間の経過も忘れるほどであった。

今回は討論会ということでもあり、講演者に日頃抱えている問題点を積極的に提起していただき、これを参加者全員で十分時間をかけて討論することに重点が置かれた。

次に討論会の内容は表面に関する問題をできるだけ広い分野から集めるということで、今回は下記の分野を含むことになった。

- (1)表面物理、(2)表面化学(触媒を含む)、(3)金属及び半導体表面、(4)微粒子の表面、界面、(5)高分子、生体の表面、界面、(6)新材料、複合材料の表面、界面、(7)表面処理、(8)表面の分析及び評価

講演時間は討論も含め20分を予定したが、議論が集

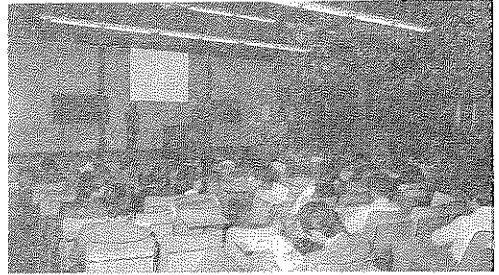


Photo. 1 討論会

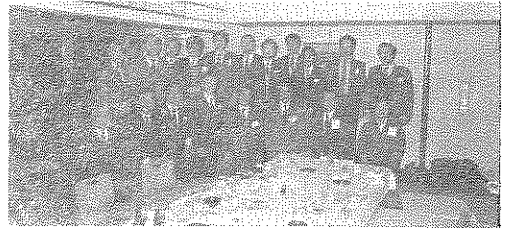


Photo. 2 懇親会(清山会長を囲んで)

中し、討論時間が延長されるものが多かった。今回は発表申込時期と実際の討論会の間に期間が多少あいたせいか、数件発表の取り消しがあったため、若干時間に余裕がとれ、かえって討論に時間がまわせたようであった。

2. 内 容

講演は招待講演と一般講演に分れ、プログラムは会誌「表面科学」第5巻4号にところみのおりであるが、数件発表の取り消しがあったため、発表時間の繰り下げや繰り上げが行われた。今回は前回に比べて、表面処理関係などの応用面での発表は少なく、薄膜、吸着などに関する基礎的な分野の発表が増したように思える。表面科学は学際的な分野であるため、表面の問題を各分野の方々が一同に会して、それぞれの立場から議論する機会を本会で提供しえたということは大変有意義であったと思える。

3. おわりに

今回は大坂理事(早大理工)のお世話で早稲田大学小野記念講堂で討論会を開催することができ、さらに早稲田大学からは開催にあたり補助金を頂きました。また、大坂研究室の皆様には運営にあたり、お世話になりました。大坂理事を始め早大関係者の方には大変感謝します。

今回は前3回と同様の形式で討論会を行いました。このような討論会という形式を今後も続けていくかどうかとか、内容、時期、会期の場所、発表数、セッション数等について、何でもお気付きの点がありましたら事務局まで御連絡いただければ幸いです。